

9. 参考文献

- 1) S. Watanabe and H. Nozoye, *Appl. Surf. Sci.* 130-132(1998)822.
- 2) S. Watanabe, K. Katsura and H. Nozoye, *Jpn. J. Appl. Phys.* January 15(1999).
- 3) 株式会社トリケミカル研究所カタログより抜粋.
- 4) F. Imai, K. Kunimori and H. Nozoye, *J. Vac. Sci. Technol.* A13(1995)2508.
- 5) 今井文一、国森公夫、野副尚一、*表面化学* 15(1994)36.
- 6) G. P. Burns, *J. Appl. Phys.*, 65(1989)2095.
- 7) S. M. Gates, *Chem. Rev.* 96(1996)1519.
- 8) H. J. Hovel, *Electrochemical Society.*
- 9) M. H. Suhail, G. Mohan Rao and S. Mohan, *J. Appl. Phys.* 71(1992)1421.
- 10) R. J. H. Clark, *The Chemistry of titanium and Vanadium*, Elsevier, Amsterdam, 1968, Chap. 9.
- 11) M. A. Buteler and D. S. Ginley, *J. Mat. Sci.* 15(1980)1.
- 12) J. Aarik, A. Aidla, A. -A. Kiisler, T. Uustare and V. Sammelselg, *Thin Solid Films* 305(1997)270.
- 13) S. J. Garrett, V. P. Holbert, P. C. Stair and E. Weitz, *J. Chem. Phys.* 100(1994)4626.
- 14) R. Wang, K. Hashimoto, A. Fujishima, M. Chikuni, E. Kojima, A. Kitamura, M. Shimohigashi, T. Watanabe, *Nature* 388(1997)431.
- 15) 太田敏孝, 山井巖, 斉藤肇, *窯業協会誌*, 87[7](1979)375.
- 16) 太田敏孝, 山井巖, 斉藤肇, *窯業協会誌*, 87[10](1979)26
- 17) V. I. Keesmann, *Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie. Band*, 346(1966)30.
- 18) Y. M. Wu, D. C. Bradley and R. M. Nix, *Appl. Surf. Sci.* 64(1993)21.

19) M. Ritala, M. Leskela, M. arkku Leskela, L. Niinisto and P. Haussalo,
Chem. Mater. 5(1993)1174.

20) M. Ritala, M. Leskela, M. arkku Leskela and E. Rauhala, Chem. Mater.
6(1994)556.

21) T. Aoki, K. Maki, Q. Tang, Y. Kumagai and S. Matsumoto, J. Vac. Sci. Technol.
A15(1997)2485.